

Плазменное Осаждение С Расширенным Испарением Pecvd Машина Покрытия

Артикул: KT-PED



Introduction

Усовершенствуйте свой процесс нанесения покрытий с помощью оборудования для нанесения покрытий методом PECVD. Идеально подходит для производства светодиодов, силовых полупроводников, МЭМС и многого другого. Осаждает высококачественные твердые пленки при низких температурах.

[Узнать больше](#)

Держатель образцов	Размер	1-6 дюймов
	Скорость вращения	0-20 об/мин регулируемый
	Температура нагрева	≤800°C
	Точность управления	±0,5°C ПИД-регулятор SHIMADEN
Газовая продувка	Расходомер	КОНТРОЛЛЕР МАССОВОГО РАСХОДОМЕРА (MFC)
	Каналы	4 канала
	Способ охлаждения	Охлаждение циркулирующей водой
Вакуумная камера	Размер камеры	φ500mm X 550mm
	Порт наблюдения	Порт полного обзора с перегородкой
	Материал камеры	316 Нержавеющая сталь
	Тип двери	Дверь открытого типа спереди
	Материал крышки	304 Нержавеющая сталь
	Порт вакуумного насоса	Фланец CF200
	Порт впуска газа	Разъем ф6 VCR
Мощность плазмы	Мощность источника	Питание постоянного тока или радиочастотное питание
	Режим соединения	Индуктивная связь или емкостная пластина
	Выходная мощность	500 Вт-1000 Вт
	Мощность биаса	500v
Вакуумный насос	Предварительный насос	15L/S Лопастной вакуумный насос
	Порт турбонасоса	CF150/CF200 620Л/С-1600Л/С
	Порт сброса давления	KF25
	Скорость насоса	Лопастной насос: 15 л/с, турбонасос: 1200 л/с, 1600 л/с
	Степень вакуума	≤5×10 ⁻⁵ Па
	Датчик вакуума	Ионизационный/сопротивление вакуумметр/пленочный манометр

Система	Электропитание	АС 220V /380 50Hz
	Номинальная мощность	5 кВт
	Размеры	900 мм X 820 мм X870 мм
	Вес	200 кг